

Fe/MgO/Fe 強磁性トンネル接合薄膜の界面の電子状態を磁気コンプトン散乱で観測。(Fe10nm/MgO1nmの実験は SPring-8-BL08W) \*磁化測定:Fe 層が薄くなるほど磁化の減少 Fe 層 界面で磁化低下

\* Fe 層内部 (100) 配向 bulk の Fe に近い電子状態 \* Fe 層界面 Fe3d の磁化減少。Fe の 4s,4p 電子の磁 化の寄与増大

## 磁気コンプトンプロファイルの磁場変化





\*磁気コンプトンプロファイルの形状に磁場依存 \*A-D(磁気飽和 2T)Fe(100)の MCP に類似。Fe100nm 内部の多結晶((100)以外の方位)も観測。 \*B-D(磁化曲線の異常 0.25T) Fe(100)の MCP を反映。Fe(100)容易軸が垂直磁化を示している。Fe10nm 層のみまたは Fe 層界面のみの MCP を観測 \*C-E(0.25T) MCP の形著しく変化。Fe(100)容易軸が ferri 結合?、伝導電子の寄与が増大?、eg 状態と t2g 状態の磁場依存性が違う? 異方性の測定が必要



\*アモルファス  $Gd_{50}Ni_{50}$  合金中の Ni の磁気モーメン ト→- $0.55\mu_{B}$ ~  $-0.91\mu_{B}$  : バルクの Ni と同程度。 \*Gd を  $7\mu_{B}$ 、伝導電子  $0.37\mu_{B}$ とすると  $Gd_{50}Ni_{50}$  あた りの磁気モーメントは 6.46~ $6.82\mu_{B}$ 。磁化測定に近い \*GdNi 合金の磁化測定 154emu/g→Gd<sub>50</sub>Ni<sub>50</sub> あたりの 磁気モーメントは  $5.99\mu_{B}$ 



E.P.Mazarakiotis et. al, Physica B, 318, p.382, 2002